高輝度軟 X 線放射光と高分解能コインシデンス分光を用いた 機能性有機・生体分子薄膜の内殻励起、オージェ、イオン脱離研究 ^{間瀬一彦(KEK 物構研、総研大、JST / さきがけ)}

1.はじめに コインシデンス分光による表面分子の内殻励起、オージェ、イオン脱離研究

放射光を利用して表面分子の内殻電子 をイオン化すると、オージェ過程を経由し てイオン脱離に到る(オージェ刺激イオン 脱離、図1)。我々は、内殻励起に由来す るダイナミクスを解明するために、オージ ェ - 光電子コインシデンス分光法 (APECS)、光電子 - 光イオンコインシデ ンス(PEPICO)分光法、オージェ電子 - 光 イオンコインシデンス(AEPICO)分光法 を開発して研究を進めている(図1)[1]。 それぞれの手法の特徴を以下に示す。 1)APECS:特定サイトの内殻イオ



ン化に由来する光電子とオージェ 図1.オ

電子を同時測定することにより、特定サイトの内殻励起に由来するオージェスペクトルを測定できる (図2)。2)PEPICO:特定サイトの内殻イオン化に由来する光電子と脱離イオンを同時測定すること により、特定サイトの内殻励起に由来する脱離イオンの質量と収量を測定できる(図3)。3)AEPICO: オージェ電子と脱離イオンを同時に測定することにより、個々のオージェ終状態に由来する脱離イオン の質量と収量を測定できる(図3)。



図2.電子 - イオンコインシデンス分光装置。 図3.オージェ - 光電子コインシデンス分光装置。

2.研究例 - 凝縮 SiF₃CH₂CH₂Si(CH₃)₃のサイト選択的イオン脱離研究 -(愛媛大理、長岡研究室との共同研究)

APECS、PEPICO、AEPICO 分光法を組み合わせるとかなり複雑な表面分子の内殻励起、オージェ、 イオン脱離過程を研究できる。ここでは一例として、凝縮 SiF₃CH₂CH₂Si(CH₃)₃の研究を紹介する。**図4** に凝縮 SiF₃CH₂CH₂Si(CH₃)₃の光電子スペクトルを示す。2つの Si サイトの化学環境が異なることを反 映して光電子ピーク Si[F] 2p と Si[Me] 2p が大きく分裂している。35 - 90 eV に Si[F] LVV と Si[Me] LVV が重複した Si LVV オージェ電子スペクトルが現れ る。Si[F] 2p と Si[Me] 2p 光電子領域において測定し た凝縮 SiF₃CH₂CH₂Si(CH₃)₃の F⁺ PEPICO(•)、H⁺ PEPICO(•)スペクトルを図5に示す。Si[F] 2p をイ オン化すると F⁺が優先的脱離し、Si[Me] 2p をイオ ン化すると H⁺の脱離が優勢になる。

Si[F] 2p - Si LVV APECS(o), Si[Me] 2p - Si LVV APECS (•)を図6に示す。Si[F] 2p - Si LVV APECS は Si[F] 2p をイオン化した場合の Si [F] LVV スペク トル、Si[Me] 2p - Si LVV APECS は Si[Me] 2p をイオ ン化した場合の Si [Me] LVV スペクトルである。両者が 大きく異なることから、Si [F] LVV オージェ過程は Si [F] サイト近傍で、Si [Me] LVV オージェ過程は Si [Me]サイ ト近傍でそれぞれ起きていることがわかった。

AEPICO 分光により得られた、Si LVV – F⁺、 Si LVV – H^{+} AEPICO スペクトルを図 6 に示す。図 4 の Si 2 p – Si LVV APECS スペクトルとの比較によりそれぞれのイオ ン脱離がどのオージェ過程に由来するかを決定できる。 図6(a)の F⁺脱離に関しては、オージェ電子運動エネル ギー (AeKE) = 43 eV、50 eV、63 eV 付近で APECS と AEPICO のピークがよい一致を示しているので、F⁺脱離 はSi[F]LVV オージェ過程に由来していると結論できる。 AeKE > 70 eV 領域で F⁺ AEPICO 収量が小さいのは、こ の領域でのオージェ過程が F の孤立電子対から起きる ためと考えられる。図6(b)の H⁺ 脱離に関しては、全 般的に APECS と AEPICO ピークの一致は良くない。こ の結果は、Si LVV オージェ終状態から直接 H⁺が脱離す るのではなく、もう一段階の電子緩和を経由して H⁺が 脱離することを示唆している。

以上の結果と考察に基づいて、F⁺脱離については、 1)Si[F]2pイオン化、2)サイト選択的Si[F]LVVオ ージェ過程によるSi[F]近傍の価電子軌道による2正孔 の生成、3)Si-F結合性軌道における電子欠損および 2正孔のクーロン反発によるF⁺のサイト選択的脱離 という機構を提案する。一方、H⁺脱離については、1) Si[Me]2pイオン化、2)サイト選択的Si[Me]LVVノ ーマルオージェ過程によるSi[Me]近傍の価電子軌道に よる2正孔の生成、3)緩和過程、4)C-H結合性軌道上 における電子欠損及び2正孔のクーロン反発によるH⁺の 脱離という機構を提案する(図7)。

この研究例が示すように、コインシデンス分光法は表面分 子の内殻励起、オージェ過程、イオン脱離機構の詳細を解明 する上で重要である。高輝度放射光と組み合わせるとコイン シデンス分光装置はさらに高感度高分解能にできる。今後は、 コインシデンス分光を用いて、有機薄膜や DNA などの生体 分子の研究を進める。

参考文献 [1] K. Mase, E. Kobayashi, and K. Isari: *Correlation Spectroscopy of Surfaces, Thin Films and Nanostructures*, Eds. J. Barakdar and J. Kirschner (WILEY-VCH, Weinheim, 2004.), pp.206-225.



図4. hv=135 eV の放射光を用いて測定した 凝縮 SiF₃CH₂CH₂Si(CH₃)₃の光電子スペクトル、 オージェ電子スペクトル。



図5. 凝縮 SiF₃CH₂CH₂Si(CH₃)₃の F⁺ PEPICO、H⁺ PEPICO スペクトル。



図6. 凝縮 SiF₃CH₂CH₂Si(CH₃)₃の Si[F] 2p - Si LVV APECS、Si[Me] 2p - Si LVV APECS。

